<u>卒業論文</u>

# <u>分子動力学法による</u> <u>Cu-Ru間の界面剥離初期過程の解明</u>

# <u>p.1-p.72完</u>

# <u>平成19年 2月 2日 提出</u>

# 指導教員 泉 聡志 助教授

# <u>50245 松本 祐樹</u>

# 目次

第1章	序論	7
1.1. 研究	究背景	7
1.2. 本言	倫文の目的	7
1.3. 本言	倫文の構成	8
第2章	シミュレーション手法	9
2.1. 分子	子動力学法	9
2.1.1.	分子動力学法について	9
2.1.2.	ビジュアライゼーションソフトウェアについて	10
2.2. 界面	<b>面剥離に対する評価手法</b>	. 11
2.2.1.	密着エネルギーによる評価手法	11
2.2.2.	せん断シミュレーション(モード)による評価手法	12
2.2.3.	せん断シミュレーション(モード)による評価手法	13
2.2. 解木	折モデルについて	15
第3章	解析結果	18
3.1. Cu	のz方向が<111>であるモデルの解析結果	18
3.1.1.	密着エネルギーによる評価	18
3.1.2.	界面に対する垂直応力による評価	19
3.1.3.	界面に対するせん断応力による評価	29
3.2. mis	sfit転位が存在しないモデルの解析結果及び考察	33
3.2.1.	接合エネルギーによる評価	33
3.2.2.	界面に対する垂直応力による評価	34
3.2.3.	界面に対するせん断応力による評価	39
3.2.4	界面剥離に対するmisfit転位の影響	42
3.3. Cu	のz方向が<011>であるモデルの解析結果	48
3.3.1.	接合エネルギーによる評価	48
3.3.2.	界面に対する垂直応力による評価	48
3.3.3.	界面に対するせん断応力による評価	53
3.4. Cu	の面方位が<001>であるモデルの解析結果及び考察	57
3.4.1.	接合エネルギーによる評価	57
3.4.2.	界面に対する垂直応力による評価	57
3.4.3.	界面に対するせん断応力による評価	62
3.4.4.	界面剥離に対するCuの面方位の影響	66

第4章	結果	. 69
参考文献…		.70

# 図目次

Fig.2.1	密着エネルギーを求めるために使用する解析モデルの概観観11
Fig.2.2	垂直応力に対する解析モデルの初期状態(概観)12
Fig.2.3	垂直応力に対する解析モデルの初期状態(き裂近傍の拡大図)13
Fig.2.4	せん断応力に対する解析モデルの初期状態(概観)14
Fig.2.5	せん断応力に対する解析モデルの初期状態(き裂近傍の拡大図)14
Fig.2.6	せん断ひずみのstep数による変化15
Fig.2.7	fcc構造及びhcp構造における原子の積層の様子16
Fig.2.8	z方向が<111>であるCuの主すべり面16
Fig.2.9	z方向が<011>であるCuの主すべり面(上)とz方向が<001>であるCuの主すべり
面(	下)
Fig.3.1.1	Cuのz方向が<111>であるモデルの初期状態の概観(密着エネルギー) 18
Fig.3.1.2	Cuのz方向が<111>であるモデルの初期状態の概観(垂直応力)19
Fig.3.1.3	引っ張りひずみのstep数による変化20
Fig3.1.4	転位射出時の zに与えるeffective strain rateの影響
Fig.3.1.5	Cuのz方向が<111>であるモデルのスナップショット(概観)23
Fig.3.1.6	Cuのz方向が<111>であるモデルのスナップショット(き裂近傍の拡大図) 24
Fig.3.1.7	${ m Cu}$ のz方向が<111>であるモデルにおける $\sigma_z$ のstep数による変動25
Fig.3.1.8	8 Cuのz方向が<111>であるモデルで主すべり面のせん断応力の解析に使用した
部分	
Fig.3.1.	9 Cuのz方向が<111>であるモデルの主すべり面におけるせん断応力のstep数に
よる	変動
Fig.3.1.1	<b>0</b> Cuのz方向が<111>であるモデルの のコンター図のスナップショット27
Fig.3.1.1	1 Cuのみのモデルにおける とstrain rateによる変動
Fig.3.1.1	<b>2</b> Cuのz方向が<111>であるモデルの初期状態の概観(せん断応力)29
Fig.3.1.	<b>13</b> Cuのz方向が<111>であるモデルの界面のスナップショット(せん断応力)
•••••	
Fig.3.1.1	<b>4</b> Cuのz方向が<111>であるモデルにおけるτ <sub>w</sub> のstep数による変動32
<b>TI A A A</b>	
Fig.3.2.1	misht転位か仔仕しないセナルの人ナッフショット(概観)
Fig.3.2.2	misht転位か存在しないモテルの人ナッフショット(き裂近傍の拡大図)…37
Fig.3.2.3	mistit転位か存在しないモテルにおける $\sigma_z$ のstep数による変動38
Fig.3.2.4	a mistit転位か存在しないモテルの王すべり面におけるせん断応刀のstep数によ
る変	19

Fig.3.2.5 misfit転位が存在しないモデルの界面のスナップショット(せん断応力)…40

**Fig.3.2.6** misfit転位が存在しないモデルにおける $\tau_{yz}$ のstep数による変動………………41

- **Fig.3.2.9** Cuのz方向が<111>であるモデルとmisfit転位が存在しないモデルにおける $\tau_{yy}$

Østep	数による変動
Fig.3.2.10	Cuの<111>面における一般化積層欠陥エネルギー曲線
Fig.3.3.1	Cuのz方向が<011>であるモデルのスナップショット(概観)50
Fig.3.3.2	Cuのz方向が<011>であるモデルのスナップショット(き裂近傍の拡大図) 52
Fig.3.3.3	Cuのz方向が<011>であるモデルにおける $\sigma_z$ のstep数による変動53
Fig.3.3.4	Cuのz方向が<011>であるモデルの界面のスナップショット(せん断応力)55
Fig.3.3.5	Cuのz方向が<011>であるモデルにおける $ au_{_{yz}}$ のstep数による変動56
Fig.3.4.1	Cuのz方向が<001>であるモデルのスナップショット(概観)59
Fig.3.4.2	Cuのz方向が<001>であるモデルのスナップショット(き裂近傍の拡大図).61
Fig.3.4.3	Cuのz方向が<111>であるモデルにおける $\sigma_z$ のstep数による変動62
Fig.3.4.4	Cuのz方向が<001>であるモデルの界面のスナップショット(せん断応力).64
Fig.3.4.5	Cuのz方向が<001>であるモデルにおける $ au_{_{yz}}$ のstep数による変動65
Fig.3.4.6	Cuのz方向がそれぞれ<111>、<011>、<001>であるモデルにおける $\sigma_z$ のstep数
による	変動67
Fig.3.4.7	Cuのz方向がそれぞれ<111>、<011>、<001>であるモデルにおける $ au_{_{yz}}$ のstep
数によ	:る変動

# 表目次

Table.2.1	GEAM ポテンシャルにおける Cu 及び Ru の物性値10
Table.3.1 いモ	転位射出時におけるCuのz方向が<111>であるモデルとmisfit転位が存在しな デルの物性値42
Table.3.2	Cu 及び Ru の $\gamma_{sf}$ 、 $\gamma_{us}$
Table.3.3	GEAM ポテンシャル、第一原理計算、実験による積層欠陥エネルギーの違い 47
Table.3.4 ມະດ	転位射出時における Cu の z 方向がそれぞれ<111>、<011>、<001>であるモデ 0物性値

## 第1章 序論

この章では、本研究で扱う Cu-Ru 界面の剥離に対する研究の現状と、本研究の目的について述べる。

#### 1.1. 研究背景

Cu-Ru 界面は実験的に剥離強度が強いことが知られていて、Ru は半導体における Cu 配 線膜の下地膜や、磁気ディスクにおける次世代材料として期待されている。近年の半導体 デバイスや磁気ディスク等の製品は、複数の薄膜材料が積層された構造を持ち、高機能化 のために各膜厚を数原子層から数十原子層(ナノメートルオーダー)にまで薄くする必要 が生じている。

このような薄膜積層構造の断面には、異種材料界面が高密度で存在することになる。異種 材料界面における原子は、界面から離れた、いわゆるバルク領域での原子に比べて動きや すく、欠陥が形成されやすいため、剥離などが発生しやすい。[1]

また薄膜間のような異種材料界面、とくに界面端(自由表面との境界部)では材料の組み 合わせと端部形状により、き裂が存在しなくても弾性応力が無限大に発散する特異応力場 になるため、破壊に優先的な箇所となる。[2]前述の製品の高性能化においても薄膜間の界 面剥離が性能向上を妨げる大きな工学的問題となっていて、界面の正確な剥離強度の評価 が急務となっている。

製品の信頼性を確保するためには、剥離強度の高い材料構成で積層構造を形成する必要が あるが、従来このような剥離強度の高い材料の組み合わせは、実験による試行錯誤により 見出されてきた。今後は製品の高機能化に伴い、使用される薄膜材料の種類が増えていく 傾向にあるため、効率的に剥離強度を求める計算技術が必要となっている。

以前はRuを分子動力学シミュレーションで取り扱うためのポテンシャルが存在しなかったが、当研究室の熊谷らが開発した GEAM ポテンシャルによりシミュレーションを行えるようになった。GEAM ポテンシャルについては第2章で詳しく述べる。

### 1.2. 本論文の目的

従来、界面の強度評価には、界面端部やき裂先端近傍を連続体近似して取り扱う線形破壊 力学に基づいた FEM や BEM といった数値解析手法が用いられてきた。[3]しかしながら、 微小構造物においては転位などの微小欠陥の挙動が界面強度の大きな支配要因となるため、 従来の連続体近手法による解析では不十分と考えられる。

そこで本研究では、分子動力学法により、分子スケールから初期界面剥離過程の基本メカ ニズムを解明することを目的とする。解析対象としては次世代デバイス材料として有望な Cu-Ruの異種金属界面を取り扱う。

### 1.3. 本論文の構成

本論文は、本章を含めて全5章から構成される。以下に各章の概要を示す。

- 第1章 序論 では異種材料界面の強度評価の現状及び適用先について述べ、本研究の目 的を示した。
- 第2章 シミュレーション手法 では本研究に用いた分子動力学法の手法と界面剥離に 対する評価手法について述べる。
- 第3章 解析結果 では各モデルの解析結果について述べる。
- 第4章 考察 では今回の解析に対する考察を述べる。
- 第5章 結果 では本研究のまとめを述べる。

# 第2章 シミュレーション手法

### 2.1. 分子動力学法

#### 2.1.1. 分子動力学法について

分子動力学法は、原子系を古典的な力学法則に支配される他質点系としてモデル化し、その運動方程式を数値的に解析することにより原子配置の時系列データを得て、物質系の巨 視特性を評価する方法である。分子動力学法では、原子間に働く力を全ポテンシャルエネ ルギーの空間勾配として計算される。

分子動力学法では、原子間相互作用を特徴づける経験的ポテンシャルを定義することで、 各原子に働く力を評価する。各原子に古典的力学法則を適用し、ニュートンの運動方程式 を数値的に解く。例えば原子数をNとし、N原子の初期条件を規定すれば6N次元の位相 空間上にただ一つの軌跡が定まり、各原子の時間発展を決定論的に追従できる。この時、 各時間ごとに系の力学量の瞬間値が定義できる。瞬間値の長時間平均が位相空間平均に等 しいというエルゴード仮説を用いれば、マクロな物理量を得ることができる。実際のシミ ュレーションアルゴリズムは、以下に示すように初期構造作成後、2~5のサイクルを繰り返 すことになる。

- 1. 初期条件作成
- 2.周期境界条件に基づき、原子間力を計算する原子対を算出(Book-keeping法)
- 3.ポテンシャルから原子間力を算出
- 4. Verlet 法により、 t後の原子位置・速度を評価
- 5.物理量の算出
- 6.2に戻る

プログラムには当研究室で使用していたプログラムを一部改良して使用した。そのプログ ラムでは、以下のようなことが出来る。複数の材料の系を扱うことが出来て、材料の面方 位も任意に設定できる。ポテンシャルには GEAM ポテンシャル、johnson ポテンシャル、 FS ポテンシャルを使用できる。任意の温度、タイムステップ、総ステップ数を指定できる。 数百万オーダーの原子数を取り扱うことが出来る。任意の原子に、任意の強制変位を与え ることが出来る。 ポテンシャルには当研究室の熊谷らが作成した GeneralizedEAM(GEAM)ポテンシャル[4]を使用する。GEAM ポテンシャルは fcc、bcc、hcp 構造を最安定構造とする異なる単体金属、並びにこれら元素の任意の組み合わせから成る合金系を表現でき、Cu/Ru 系の界面計算を実現できる。

Table.2.1 に GEAM ポテンシャルの基本物性値を示す。

	Cu	Ru ( misfit 有り )	Ru ( misfit 無し )
a <sub>0</sub> ( )	3.615	2.685	2.686
c <sub>0</sub> ( )	-	4.353	4.348
$E_0$ (eV/atom)	-3.54	-6.74	-6.74
B [GPa]	116.4	309.2	309.2
µ [GPa]	54.0	128.9	117.1

Table.2.1 GEAM ポテンシャルにおける Cu 及び Ru の物性値

2.1.2. ビジュアライゼーションソフトウェアについて

本研究ではビジュアライゼーションソフトウェアとして、無料の原子配列可視化ソフトウェア、AtomEyeを使用した。

AtomEye には次のような機能がある。

- 描写の仕方は、平行投影法と遠近法の二種類があり、どちらも三次元で操作可能(回転・拡大縮小・平行移動など)。
- 共有結合数と配位数を計算ができる。
- 着色の仕方は、元素の種類による着色のほかに、配位数による着色、ユーザが定義した物性値による着色などができる。
- 着色をユーザが任意に設定できる。
- 原子の局所的なひずみは着色に考慮されない。
- 任意の色の原子を消去できる。
- 任意の面で切断できる。
- 周期境界条件で平行移動させられる。
- JPEG、PNG、EPS での画像保存及びアニメーション作成ができる。

### 2.2. 界面剥離に対する評価手法

本研究では、界面剥離に対する強度を三つの観点から評価していく。本節では、その三つの評価手法について議論していく。一つ目は接合エネルギーによる評価手法、二つ目は界面に対する垂直応力による評価手法、三つ目は界面に対するせん断応力による評価手法である。

#### 2.2.1. 密着エネルギーによる評価手法

この評価手法は、剥離を生じさせる上で必要なエネルギーを、密着エネルギーによって見 積もる手法[5]である。変形によるエネルギーを考慮しなくても良い脆性的な破壊が生じた 場合、異種材料の密着した状態と、離れた状態を比較すれば剥離に必要なエネルギーを見 積もることが出来る。直感的にも剥離に必要なエネルギーを予測出来るのではないか。

解析モデルの概観を**Fig.2.1**に示す。密着エネルギーは $W_{ad}$  = + – と定義される。ここで、、は材料、のそれぞれの表面エネルギーで、 は、材料、

間の界面エネルギーである。実際には異種材料が界面を介して密着している系 (material-connected state)のポテンシャルエネルギーと、それぞれの材料が単体で存在 する系(material-separated state)のポテンシャルエネルギーを比較し、二つのポテンシ ャルエネルギーの差を単位面積当たりに換算し、算出した。この密着エネルギーWadが大き いほど、密着性が高い。



#### Fig.2.1 密着エネルギーを求めるために使用する解析モデルの概観

Material-connected state と material-separated state のそれぞれを分子動力学法で平衡 状態に至るまでシミュレーションを行い、収束したポテンシャルエネルギーを比較した。 ポテンシャルには前述の GEAM ポテンシャルを使用した。計算条件として、温度は 0[K] 一定に保ち、1 step を 1.08[fs]とし、Verlet の時間積分法で運動方程式を解き、全原子の運 動を追跡した。x,y 方向は周期境界条件、z 方向は自由境界を適用した。

#### 2.2.2. せん断シミュレーション(モード)による評価手法

この評価手法では、界面に対する垂直応力を加え、垂直応力が転位及びき裂の進展にどの ように寄与しているかを検証した。前項の評価手法だと、剥離に至るまでの材料の変形が 全く考慮されていない。そこで界面に対する垂直応力を加えて、変形の様子を観察すると ともに、面欠陥周辺の応力状態、転位進展の様子などを観察し、それが剥離にどのような 影響を与えているかを考察する。

2.2.1 で作成したモデル(material-connected state)の界面上に空洞を挿入し、上下面を 変位拘束しz方向に強制変位を与えて運動方程式を解き、全原子の運動を追跡、き裂及び転 位の進展を観察した。モデルの全体図を Fig.2.2 に、き裂近傍の拡大図を Fig.2.3 にそれぞ れ示す。

計算条件として、ポテンシャルは前述の GEAM ポテンシャルを使用し、x,y 方向は周期 境界条件、z 方向は自由境界を適用した。温度は 1[K]で一定に保ち、1step を 1.08[fs]とし た。モデルの z 方向の上下端面それぞれ 7 層を変位拘束し、計算の始めに 5000step( 5.4[ps] ) の緩和計算を行った後、拘束原子に対して強制変位を与えた。

強制変位の大きさはひずみ速度に換算して与えたが、ひずみ速度については、第3章で議 論を行う。またその他のモデルごとに異なる条件についても第3章で記述する。





Fig.2.3 垂直応力に対する解析モデルの初期状態(き裂近傍の拡大図)

### 2.2.3. せん断シミュレーション(モード)による評価手法

この評価手法では、界面に対するせん断応力を加え、せん断応力が転位及びき裂の進展に どのように寄与しているかを検証した。界面剥離には、界面に対する垂直応力だけではな く、せん断応力も寄与していると考えられる。そこで界面に対するせん断応力を加えて、 変形の様子を観察するとともに、面欠陥周辺の応力状態、転位進展の様子などを観察し、 それが剥離にどのような影響を与えているかを考察する。

モデルの全体図を Fig.2.4 に、き裂近傍の拡大図を Fig.2.5 に示す。2.2.2 と異なる点は、 空洞を界面端部に挿入したこと、強制変位を y 方向に与えたこと、境界条件を x 方向のみ 周期境界条件とし、y、z 方向は自由境界にしたこと、である。界面上に作成したき裂の y 方向長さは 6.0[nm]、z 方向長さは 0.65[nm]である。



Fig.2.4 せん断応力に対する解析モデルの初期状態(概観)



Fig.2.5 せん断応力に対する解析モデルの初期状態(き裂近傍の拡大図)

**2.2.2** と同じく、ポテンシャルに GEAM ポテンシャルを使用し、温度は 1[K]で一定に保 ち、1step を 1.08[fs]とした。計算の始めに 5000step (5.4[ps])の緩和計算を行い、その後 強制変位を与えた。総 step 数は 25,000step (27ps)である。

強制変位のstep変動を**Fig.2.6** に示す。5000stepの緩和計算を行った後に、100step (0.1[ps])の間強制変位を与え、100step(0.1[ps])の間緩和計算を行うことを繰り返した。 強制変位はひずみ速度 =4.5 × 10 [m/s]相当とした。

その他、各解析モデルで異なる計算条件については第3章で記述する。



**Fig.2.6** せん断ひずみの step 数による変化

### 2.2. 解析モデルについて

本研究では、大きく分けて3種類の解析モデルについてシミュレーションを行った。本節 ではそれぞれのモデルについて記述する。本研究では界面に存在する misfit 転位と Cu の 面方位が界面剥離にどのような影響を与えるのかを考察する。最初に基準となるモデルに ついて検証を行った後、比較対象として、misfit 転位が存在しないモデル及び Cu の面方位 を変更したモデルについて検証していく。misfit 転位とは、格子定数の異なる二つの材料の 界面に出来る転位のことである。

最初のモデルは現実的なモデルである。misfit 転位が存在し、Cu の面方位は z:<111>, x:<10-1>, y:<-12-1>である。Ru の面方位についてはどのモデルも z:<0001>, x:<11-20>, y:<-1100>とした。

Cu は fcc 構造、Ru は hcp 構造が最安定構造である。fcc 構造及び hcp 構造における原子 の積層の様子を **Fig.2.7** に示す。Cu の z 方向が<111>であるモデルでは、Cu の z 方向が Fig.2.7 の左下の図での紙面鉛直上方に当たり、Ru の z 方向が Fig.2.7 の右下の図での紙面 鉛直上方に当たる。この面方位は界面の misfit 転位が最も少なくなる。よってこのモデル



を基準とした。Fig.2.8 にこのモデルに Cu における転位のすべり面を示す。

Fig.2.7 fcc 構造及び hcp 構造における原子の積層の様子



Fig.2.8 z方向が<111>である Cu の主すべり面

次のモデルは misfit 転位が存在しない仮想的なモデルである。Cu 及び Ru の面方位は最初のモデルと同じである。Cu の側の主すべり面は最初のモデルと等しい。

異種材料界面はコヒーレントな状態と、インコヒーレントな状態になり得る。インコヒー レントな状態とは、材料が弾性変形を起こしておらず、misfit 転位が存在する状態であり、 これは最初のモデルの状態である。一方コヒーレントな状態とは、どちらかの材料が弾性 変形を起こしていて、misfit 転位が存在する状態である。ここではき裂及び転位の進展に misfit 転位が与える影響のみを検証するため、弾性変形による影響を除去する。つまり misfit 転位は存在しないが、弾性変形も生じていない状態を作成する。

この状態を実現するため、RuのGEAMポテンシャルに、格子定数をCuの格子定数を等 しくしたものを使用した。その他の材料特性については、格子定数を変化させる前と等しい。

このような Ru は現実には存在しないが、モデルとして取り上げた理由として、misfit 転 位が界面剥離に与える影響や部分転位射出への影響を検証すること、物性値を比較するこ と、が挙げられる。

最後は Cu の面方位を変更したモデルである。ここでは Cu の面方位が z:<110>, x:<001>, y:<-110>のモデルと、z:<001>, x:<100>, y:<010>の二つのモデルについてシミュレーショ ンを行った。この二つのモデルにおける Cu の主すべり面を **Fig.2.9** に示す

微小構造物においては転位などの微小欠陥の挙動が界面強度の大きな支配要因となるが、 面方位が変わると転位の射出されるすべり面も回転する。つまり転位が射出される方向が 異なってくる。そのことが界面剥離に与える影響について検証する。

この二つと最初のモデルより、Cuの面方位が界面剥離に与える影響について検証した。



**Fig.2.9** z 方向が<011>である Cu の主すべり面(上)と z 方向が<001>である Cu の主す べり面(下)

# 第3章 解析結果

本章では、前章の方法で各モデルを解析した結果について論じていく。

### 3.1. Cuのz方向が<111>であるモデルの解析結果

本節では Cu の面方位の z 方向が<111>であり、界面に misfit 転位が存在するモデルについての解析結果について論じる。

#### 3.1.1. 密着エネルギーによる評価

Fig.3.1.1 に解析モデルを示す。

material-connected state の計算系(Cu-Ru系)は x=10.5nm、y=18.2nm、z=10.6nm で あり、総原子数は 161,700 個とした。material-separated state の Cu の計算系(Cu 単体 系)は x=10.5nm、y=18.2nm、z=6.3nm で、総原子数を 100,860 個、一方 Ru の計算系(Ru 単体系)は x=10.5nm、y=18.2nm、z=4.3nm であり、総原子数を 60,840 個とした。



Fig.3.1.1 Cuのz方向が<111>であるモデルの初期状態の概観(密着エネルギー)

平衡状態のエネルギーを求めると Cu-Ru 系が-760,091[eV]、Cu 単体系が-353,477[eV]、 Ru 単体系が-401,200[eV]となった。material-connected state と material-separated state の差は 5,414[eV]であり、これを界面の面積で割り、単位面積当たりに換算し、単位変更を 行うと、4.56[J/m<sup>2</sup>]であった。

#### 3.1.2. 界面に対する垂直応力による評価

Fig3.1.2 に解析モデルの全体図を示す。

計算系は x=10.5nm、y=18.2nm、z=12.8nm であり、総原子数を 190,545 個とした。



Fig.3.1.2 Cuのz方向が<111>であるモデルの初期状態の概観(垂直応力)

ここで強制変位の与え方について論じていく。強制変位の step 変動を **Fig.3.1.3** に示す。 実際のシミュレーションで強制変位は、**Fig3.1.3**の real strain rate のように 100step(0.1[ps])の間、強制変位を与えて、その後 100step(0.1[ps])の間、緩和計算を行うこ とを繰り返した。

強制変位の与え方が転位の進展にどのように寄与しているかを観察するため、**Fig3.1.3**の effective strain rate を考えた。強制変位間の緩和計算がなく、強制変位が常に与えられた と仮定した場合の一定値を effective strain rate とした。強制変位をいくつかの条件で与え、 最初の転位が射出されるときの $\sigma_z$ に対する effective strain rate の影響を **Fig3.1.4** にまと めた。



Fig.3.1.3 引っ張りひずみの step 数による変化



Fig3.1.4 転位射出時の z に与える effective strain rate の影響

effective strain rateが大きいほど、 zも大きくなるが、effective strain rateが小さくなるにつれ zがある一定の値に収束することが分かった。従って解析ではeffective strain rateとして $7.5 \times 10^8$  [ $s^{-1}$ ]を使用した。正確にはひずみ速度 = $1.5 \times 10^9$  [ $s^{-1}$ ]の強制変位を 100step (0.1[ps])与えた後、100step (0.1[ps])の緩和計算を行うことを繰り返した。

総 step 数は 65,000step(時間にすると、70[ps])として、その間に与えたひずみは、4.86% であった。

**Fig.3.1.5** に解析結果概観のスナップショットを示す。左図は fcc 構造、hcp 構造を保って いる原子は消去することで、自由境界、転位芯等の欠陥原子のみを可視化した。正確には、 配位数により着色した後、正常な fcc 構造、hcp 構造の配位数は 12 個であるから、配位数 が 12 個である原子を消去し、欠陥原子のみを可視化した。右図は、このモデルを主すべり 面に沿って切断し、*σ*<sub>z</sub> についてのコンター図で表現した。最大値は 17,000[MPa]で、最小 値は-3,000[MPa]である。局所的に値がこの範囲に入らない原子もあるが、その原子はカラ ーマップ外の色かつ彩度の低い色で表現している。

**Fig.3.1.5**の左図より Cu/Ru 界面に misfit 転位の存在を観察することが出来た。Cu に部 分転位は射出されたが、Ru には射出されなかった。Cu に対しては、き裂右端から部分転 位がすべり面に沿って射出している様子が観察された。部分転位の形状は misfit 転位の形 状に影響を受けて、直線ではなく曲線となった。しかし射出された部分転位は、z 方向上方 の変位拘束原子に到達すると、その部分転位はそれ以上進展しなかった。現実では転位は 表面に突き抜けるので、この挙動は現実のものとは乖離している。

**Fig.3.1.5**の右図を観察する。界面上とき裂周辺の原子の $\sigma_z$ は、部分転位の挙動に関係な く高くなっていた。まだ強制変位を与えていない緩和計算終了時でも高い応力が観察でき るので破壊に優先的な箇所であることが分かる。また転位芯の $\sigma_z$ は高いが、すでに転位が すべった部分の $\sigma_z$ は緩和されていた。変位拘束原子の $\sigma_z$ は正確な値ではないので、無視 して良いと考えられる。





















31[ps]



**Fig.3.1.5** Cuのz方向が<111>であるモデルのスナップショット(概観)

**Fig.3.1.6** にき裂近傍の拡大図のスナップショットを示す。き裂は次第に大きくなったものの、界面方向には進展せず、界面と垂直方向に Cu のみに進展してゆき、次第に先端が鈍化していった。Cu 側では界面と平行方向にやや進展した。つまり Ru は剛性が高く、またCu-Ru 界面の密着度も強いことが確認できた。



5.4[ps] (緩和計算終了時)

30[ps]



43[ps]

70[ps]

Fig.3.1.6 Cuのz方向が<111>であるモデルのスナップショット(き裂近傍の拡大図)

**Fig.3.1.7** に全原子  $\sigma_z$ を平均した値の step 数による推移を示す。最初の部分転位を観察 したときの物性値は、 $\sigma_z = 5.2 \times 10^3$  [MPa]、 =1.78[%]、step = 27,000 であった。全体の 平均応力を見ると、部分転位の射出で応力が緩和された様子は観察できなかった。

また 40,000[step]以降で*σ*<sub>z</sub>が収束しているが、これは変位拘束原子により転位が反射されて、モデルの Cu 全体に転位が広がったことに起因する。



**Fig.3.1.7** Cuのz方向が<111>であるモデルにおけるσ,の step 数による変動

次に部分転位とすべり面に沿ったせん断応力の関係について検証する。転位は Ru 側には 進展せずに、Cu 側のみ進展していたので、Cu で主すべり面に沿った 6 層の原子について 詳しく観察を行った。この条件に当てはまっていても変位拘束原子は考慮しなかった。 Fig.3.1.8 に解析に用いたモデルの部位を示す。Fig.3.1.8 で黒線で囲まれた部分を奥行き方 向に抜き取ったモデルについて解析を行った。このモデルの原子数は 5,330 個であった。

**Fig.3.1.9** にこのモデルの主すべり面におけるせん断応力の平均値の step 数による変動を 示す。データは 200[step] ごとに取ったのだが、最大値は 26,800[step] のときで、 1.30×10<sup>3</sup> [MPa]であった。その後 27,000[step]で部分転位が射出され、急激な応力緩和が 起きていた。つまり応力集中により部分転位が射出され、部分転位射出によって応力緩和 が起きていた。

40,000[step]前後で応力緩和が起きているが、これは変位拘束原子により転位が反射し、 モデル全体に急激に広がっていったためである。

Fig.3.1.10 に部分転位が射出された前後のスナップショットを示す。せん断応力をコンタ ー図により表現した。最大値は 3,000[MPa]、最小値は 0[MPa]であり、局所的に存在する カラーマップ外のせん断応力を持つ原子はカラーマップ外の色かつ彩度の低い色で表現し た。外側にある黒線は、元のモデルの枠線である。



**Fig.3.1.8** Cuのz方向が<111>であるモデルで主すべり面のせん断応力の解析に使用した 部分



**Fig.3.1.9** Cuのz方向が<111>であるモデルの主すべり面におけるせん断応力のstep数による変動



Fig.3.1.10 Cuのz方向が<111>であるモデルののコンター図のスナップショット

**Fig.3.1.10**より、部分転位の射出により、せん断応力が大きく緩和されている様子が分かる。**Fig.3.1.5** での*σ*<sub>2</sub>の応力緩和よりもはっきりとしている。27,000[step]では、界面近くの原子に応力集中が起きている様子が観察できた。このスナップショットからも応力集中部から部分転位が射出され、応力が緩和されている様子が確認できた。

ここで、このシミュレーションの妥当性を検討していく。Cu のみのモデルで Cu の面方 位が<111>であるモデルと同じすべり面にせん断応力を与えた場合の結果を Fig.3.1.11 に 示す。せん断応力と与えたひずみの関係である。Fig.3.1.11 より Cu の臨界分解せん断応力 が求まり、その値は2.89×10<sup>3</sup> [MPa]であった。Fig.3.1.9 で求めたせん断応力の最大値は 1.30×10<sup>3</sup> [MPa]なので、この値のみに注目すると良い妥当性だとは言えない

しかし Fig.3.1.9 と Fig.3.1.11 はグラフの形状はほぼ同じである。また Fig.3.1.9 を求めた モデルには、部分転位が射出される箇所から離れている原子も含まれていた。せん断応力 を求めるための原子を、もっと部分転位に近い原子に限定すれば、最大値が臨界分解前段 応力に近づいていくと考えられる。また部分転位が射出される箇所の近傍の原子のせん断 応力を個別に観察すると、2.5×10<sup>3</sup> ~ 4.0×10<sup>3</sup> [MPa]程度の値が得られた。このようなこ とから、このシミュレーションには妥当性があると言える。



Fig.3.1.11 Cuのみのモデルにおける と strain rate による変動

#### 3.1.3. 界面に対するせん断応力による評価

Fig.3.1.12 に解析モデルの全体図を示す。

計算系は x=10.5nm、y=18.2nm、z=12.8nm であり、総原子数を 188,196 個とした。



**Fig.3.1.12** Cuのz方向が<111>であるモデルの初期状態の概観(せん断応力)

Fig.3.1.13 に界面のスナップショットを示す。Fig.3.1.12 の AB 間を z 方向の上方から観察したスナップショットである。左図では配位数により着色した後、fcc 構造及び hcp 構造を保っている原子を消去し界面上の欠陥原子と y 方向の自由境界原子のみを可視化した。

右図は、 *τ*<sub>vz</sub>によるコンター図である。最大値は 6,000[MPa]で、最小値は-3000[MPa]であ

る。局所的に値がこの範囲に入らない原子もあるが、その原子はカラーマップ外の色かつ 彩度の低い色で表現している。

初期状態から緩和計算終了時までは新たな misfit 転位は出現しなかったが、個々の転位が細くなり、また形状も三角形に回転が加わったものに変化した。misfit 転位上の  $\tau_{yz}$ は周

辺の $\tau_{yz}$ よりも大きくなっている。

その後強制変位を与えるにつれて、5.4~16[ps]では misfit 転位が **Fig.3.1.13** の右方向に 進展していった。右端に存在した misfit 転位はこの過程で表面に達し、消滅している。

16[ps]では界面上き裂端の Twがとても高くなっていて、その結果 19[ps]では新たな misfit

転位が射出された。それに伴い界面上き裂端の $au_{_{yz}}$ がやや緩和されている。



0[ps](初期状態)



5.4[ps] (緩和計算終了時)







16[ps]



**Fig.3.1.13** Cuのz方向が<111>であるモデルの界面のスナップショット(せん断応力)

全体としては左図と右図を見比べると、misfit 転位は界面上のせん断応力を緩和しながら 移動して、最後は表面に抜けていく様子が観察された。misfit 転位上の  $\tau_{yz}$ は他の部分より も高い値だが、misfit 転位がすべった部分の応力は緩和されている。垂直応力を与えたとき の部分転位の働きと同じ働きが確認できた。

界面上でも 3.1.2 のときのように応力が集中するとその部分より転位が射出されていた。

**Fig.3.1.14** にこのモデルにおける  $\tau_{y_z}$ の step 数による変動を示す。ここで  $\tau_{y_z}$ は全原子の

平均値である。緩和計算終了後、強制変位を与えるにつれて *τ<sub>v</sub>* は増加しているが、

Fig.3.1.13 で観察した新たな misfit 転位の射出により応力緩和されている。総ひずみは前 項、垂直応力を与えたときと等しく、4.86[%]だが、応力の値はかなり小さくなっている。 また応力緩和も垂直応力を与えたときよりもせん断応力を与えたときの方がはっきりと観 察できた。このことよりも misfit 転位はせん断応力を緩和する働きがあると言える。



**Fig.3.1.14** Cuのz方向が<111>であるモデルにおける $\tau_{yz}$ の step 数による変動

### 3.2. misfit 転位が存在しないモデルの解析結果及び考察

本節では misfit 転位が界面隔離や転位の進展に与える影響を調べるため、前節で扱った モデルの misfit 転位が存在しないモデルの解析を行った。ポテンシャルには、Ru の材料特 性を変化させず、格子定数のみ Cu の格子定数と等しくさせた GEAM ポテンシャルを使用 した。

#### 3.2.1. 接合エネルギーによる評価

Ru のポテンシャル変更に伴い、計算系が若干変化した。material-connected state の計 算系(Cu/Ru 系)は x=10.5nm、y=18.2nm、z=10.6nm であり、総原子数は 171,462 個と した。material-separated state の Cu の計算系(Cu 単体系)は x=10.5nm、y=18.2nm、 z=5.6nm で、総原子数を 90,774 個、一方 Ru の計算系(Ru 単体系)は x=10.5nm、y=18.2nm、 z=5.0nm であり、総原子数を 80,688 個とした。

面方位及びその他の条件はCuのz方向が<111>であるモデルと等しい。

平衡状態のエネルギーを求めると Cu-Ru 系が-858,586[eV]、Cu 単体系が-317,773[eV]、 Ru 単体系が-534,463[eV]となった。material-connected state と material-separated state の差は 6,350[ev]であり、これを界面の面積で割り、単位面積当たりに換算し、単位変更を 行うと、5.35[J/m<sup>2</sup>]であった。

#### 3.2.2. 界面に対する垂直応力による評価

計算系は x=10.5nm、y=18.2nm、z=12.5nm であり、総原子数を 200,121 個とした。面 方位及びその他の条件は Cu の z 方向が<111>であるモデルと等しくした。

**Fig.3.2.1** に、解析結果概観のスナップショットを示す。Cuのz方向が<111>であるモデ ルのスナップショットと同様に、左図は自由境界原子、欠陥原子のみを可視化した。右図 は、解析モデルを主すべり面に沿って切断し、σ<sub>z</sub>をコンター図で表現した。最大値、最小 値及びカラーマップはCuのz方向が<111>であるモデルと等しくした。

Fig.3.2.1 の左の図より、格子定数を等しくしたことで Cu/Ru 界面の misfit 転位がなくなった様子が観察された。やはり Ru 側には転位は進展せず Cu 側にのみ部分転位が進展していった。15[ps]の図で、き裂の左端に部分転位が射出されたが、この転位は進展せずに計算を進めるにつれ消えた。その後、Cu の z 方向が<111>であるモデルと同じく、き裂右端のすべり面に沿って部分転位が射出され、進展していった。転位芯の形状は Cu の z 方向が<111>であるモデルと異なり、直線となった。部分転位の形状は最初に射出される界面の形状に大きく影響を受けると言える。一時的には、き裂左端に沿ったすべり面上のせん断応力が高くなったが、最終的にき裂右端に沿ったすべり面上のせん断応力のほうが高くなり、 左からのは転位が進展せずに、右からの転位が進展したと考えられる。しかしこの部分転位も変位拘束原子まで至るとそこで進展が止まり、表面に突き抜けることはなかった。

**Fig.3.2.1** の右の図を観察する。き裂周辺では Cu の z 方向が<111>であるモデルと同じく、応力集中が起きているが、界面上では、Cu の z 方向が<111>であるモデルほどの応力集中は観察できなかった。転位芯の $\sigma_z$ が高く、部分転位がすべった面の応力が緩和されているのも Cu の z 方向が<111>であるモデルと同様である。き裂の存在しない界面の上下の原子は Cu の z 方向が<111>であるモデルと比較して、応力集中はなく、全体に平均して応力が加わっている。



















45[ps]



Fig.3.2.1 misfit 転位が存在しないモデルのスナップショット(概観)
Fig.3.2.2 にき裂近傍の拡大図のスナップショットを示す。き裂は次第に大きくなったものの、Cuのz方向が<111>であるモデルと同様、き裂はy方向には進展せず、z方向のCu側にのみ進展した。それにつれて先端が鈍化していった。き裂の進展の様子にCuのz方向が<111>であるモデルとの大きな違いは見られなかった。局所的な応力集中を除けば、misfit転位の有無がCu/Ru界面の密着度に大きな影響を与えていないと考えられる。



5.4[ps] (緩和計算終了時)

30[ps]



50[ps]

70[ps]

Fig.3.2.2 misfit 転位が存在しないモデルのスナップショット(き裂近傍の拡大図)

**Fig.3.2.3** に全原子  $\sigma_z$ を平均した値の step 数による推移を示す。き裂右端から転位が射出されたときの物性値は、 $\sigma_z = 4.2 \times 10^3$  [MPa]、 =1.38[%]であった。全体の平均応力を見ると、部分転位の射出で応力が緩和された様子は観察できなかった。応力の推移の様子に Cu の z 方向が<111>であるモデルと大きな違いは見られなかった。

また 50,000[step]以降で*σ*<sub>z</sub>が収束しているが、これは変位拘束原子により転位が反射されて、モデルの Cu 全体に転位が広がったからだと考えられる。



**Fig.3.2.3** misfit 転位が存在しないモデルにおける  $\sigma_r$ の step 数による変動

次にすべり面におけるせん断応力と部分転位の進展について検証していく。転位は Ru 側 には進展せずに、Cu 側のみ進展していたので、主すべり面に沿った 6 層の Cu 原子につい て詳しく観察を行った。観察した原子の位置は Cu の z 方向が<111>であるモデルと等しい。 原子数は 5,002 個であった。

Fig.3.2.4 に主すべり面におけるせん断応力の step 数による変動を示す。データは 200step ごとに取ったのだが、最大値は 21,600[step]のときで、1.13×10<sup>3</sup> [MPa]であった。その後 急激な応力緩和が起きていた。最初の部分転位が射出されたのは、22,000[step]のときなの で、部分転位の射出直前は応力集中があり、射出によって応力が急激に緩和されたことが 分かった。

妥当性の検討に関しても、原子を取り出している位置、個数、せん断応力の最大値が前節 のモデルと同じなので、良いと言える。



Fig.3.2.4 misfit 転位が存在しないモデルの主すべり面におけるせん断応力の step 数による変動

#### 3.2.3. 界面に対するせん断応力による評価

計算系は x=10.5nm、y=18.2nm、z=12.5nm であり、総原子数を 197,620 個とした。面 方位及びその他の条件は Cu の z 方向が<111>であるモデルと等しい。

このモデルでは misfit 転位が存在しないので、Cu の z 方向が<111>であるモデルに見られた界面における転位の挙動は見られなかった。**Fig.3.2.5** に界面のスナップショットを示す。この図は *r*<sub>y2</sub>のコンター図である。最大値、最小値及びカラーマップは Cu の z 方向が<111>であるモデルと等しくした。

Cuのz方向が<111>であるモデルと異なり、界面上に局所的な応力集中は見られない。 き裂近傍の応力が高く、右端にいくにつれて応力が徐々に低くなっている。27[ps]のときの 図を見比べると明確に分かるが、misfit 転位存在しないモデルのほうが全体の  $\tau_{yz}$ は大きく なっている。



Fig.3.2.5 misfit 転位が存在しないモデルの界面のスナップショット(せん断応力)

**Fig.3.2.6** にこのモデルにおける  $au_{yz}$ の step 数による変動を示す。ここでの  $au_{yz}$ は全原子の 平均値である。

5000step の緩和計算のあと、応力緩和が起きることなく、 $\tau_{yz}$ が上昇し続けている。 Fig.3.2.5 のスナップショットで確認したことがここでも確認できた。Cu の z 方向が<111> であるモデルにおける $\tau_{yz}$ の最大値は 6.0 × 10<sup>2</sup>、一方このモデルにおける $\tau_{yz}$ の最大値は 3.1 × 10<sup>3</sup>[MPa]と、6 倍大きな値であった。つまり misfit 転位が存在しないので $\tau_{yz}$ が緩和され

なかったことが分かった。



**Fig.3.2.6** misfit 転位が存在しないモデルにおける  $au_{yz}$ の step 数による変動

#### 3.2.4 界面剥離に対する misfit 転位の影響

本項では、misfit 転位による界面剥離に対する影響を考察するため、Cuのz方向が<111> であるモデルと misfit 転位が存在しないモデルを比較する。

まず密着エネルギーによる評価。密着エネルギーの定義より、密着エネルギーが大きけれ ば大きいほど、Cu と Ru がそれぞれ単体で存在するよりも Cu/Ru の接合状態のほうが安定 であると言える。

第3章で求めた密着エネルギーは、Cuのz方向が<111>であるモデルが4.56[J/m<sup>2</sup>]、misfit 転位が存在しないモデルが5.35[J/m<sup>2</sup>]であった。Cuのz方向が<111>であるモデルのほう がmisfit 転位が存在しないモデルより15%小さくなった。つまり接合エネルギーのみを考 慮すると、Cuのz方向が<111>であるモデルはmisfit 転位が存在しないモデルに比べて不 安定である。

次に界面に対する垂直応力による評価。両モデルの最初の部分転位が射出されたときの物性値の比較を Table.3.1 に示す。

Cu の z 方向が<111>であるモデルのほうが、 $\sigma_z$ では 24%、 では 29%だけ、それぞれ misfit 転位が存在しないモデルより大きな値となった。

	$\sigma_z$ [MPa]	[%]	step
Cu の z 方向が<111> であるモデル	5.2×10 <sup>3</sup>	1.78	27,000
misfit 転位が存在し ないモデル	4.2×10 <sup>3</sup>	1.38	22,000

# **Table.3.1** 転位射出時における Cuのz方向が<111>であるモデルとmisfit 転位が存在しな いモデルの物性値

接合エネルギーの観点からは不安定な Cu の z 方向が<111>であるモデルのほうが、垂直 応力に対しては部分転位が射出されにくく、安定している。このことより misfit 転位の存 在が部分転位の射出を阻害している、もしくは垂直応力を緩和していると考えられる。

**Fig.3.2.7** に Cu の z 方向が<111>であるモデルと misfit 転位が存在しないモデルにおける  $\sigma_z$ の step 数による変動を示す。転位射出時の周辺では二つの値に大きな差は見られない。 よって misfit 転位に垂直応力を緩和する働きはないが、部分転位の射出を妨げる働きはあることが分かった。



**Fig.3.2.7** Cuのz方向が<111>であるモデルとmisfit転位が存在しないモデルにおける $\sigma_z$ の step 数による変動

両モデルのき裂に進展の仕方を比較してみても、この程度のひずみでは界面の密着強度に は misfit 転位の存在は影響を及ぼさなかった。しかしひずみがさらに大きくなると、界面 上に応力集中場ができる Cuのz方向が<111>であるモデルのほうが剥離しやすいと考えら れる。

二つのモデルの主すべり面におけるせん断応力の比較を行う。Fig.3.2.8 に Cu の z 方向が <111>であるモデルと misfit 転位が存在しないモデルにおけるせん断応力とひずみの変動 を示す。部分転位が射出されるまでは、どちらのモデルもほぼせん断応力であった。しか し部分転位の射出に伴い、どちらのモデルでも大きく応力が緩和されていた。転位射出時 のひずみは Cu の z 方向が<111>であるモデルは 1.78[%]、misfit 転位が存在しないモデル では 1.38[%]であった。

Fig.3.2.8 より misfit 転位は主すべり面の応力も緩和はしないことが観察できた。misfit 転位が存在すると界面上で応力集中があるが、すべり面にまでは影響がなかった。両モデ ルともせん断応力の平均値はほぼ同じように推移していったが、局所的に考えると misfit 転位が存在するほうが応力集中場が形成されているはずである。misfit 転位の存在はそれ以 上に部分転位の射出を妨げることが分かった。



**Fig.3.2.8** Cuのz方向が<111>であるモデルとmisfit転位が存在しないモデルにおけるせん断応力とひずみの変動

界面に対するせん断応力による評価。Cu の z 方向が<111>であるモデルと misfit 転位が存在しないモデルにおける  $\tau_{yz}$ の step 数による変動を Fig.3.2.9 に示す。7000step くらいまでは Model A、B とも同じような値だったが、その後の  $\tau_{yz}$ は Cu の z 方向が<111>である モデルのほうが明らかに小さかった。両モデルの  $\tau_{yz}$ の最大値を比較すると Cu の z 方向が <111>であるモデルは misfit 転位が存在しないモデルの 1/6 程度だった。つまり misfit 転位はせん断応力を緩和する働きがあることが確認できた。



**Fig.3.2.9** Cuのz方向が<111>であるモデルとmisfit 転位が存在しないモデルにおける $\tau_{_{VZ}}$ の step 数による変動

解析を通して、両モデルともに Ru への転位の進展は確認できなかった。このことを説明 するため、積層欠陥エネルギーについて考察する。

積層欠陥とは面欠陥の一種であり、二本の部分転位の間に生じる。そしてその面積に反比 例する積層欠陥エネルギーを持っている。積層欠陥エネルギーが大きいほど、部分転位が 射出されづらく、また射出されても進展しづらい。

**Fig.3.2.10** に GEAM ポテンシャルを利用して求めた C u の一般積層欠陥エネルギー曲線 を示す。横軸は正常な fcc 構造からのずれ、縦軸は欠陥エネルギーを示している。

このグラフの最大値が不安定積層欠陥エネルギー( $\gamma_{us}$ )で、右端の値(転位が完全にす べった時の値)が積層欠陥エネルギー( $\gamma_{sf}$ )となる。



Fig.3.2.10 Cuの<111>面における一般化積層欠陥エネルギー曲線

Table.3.2 に GEAM を使用して当研究室の原らが求めた Cu と Ru の積層欠陥エネルギーと不安定積層欠陥エネルギーを示す。[6]

	Cu	Ru misfit 有り	Ru misfit 無し
<111> $\gamma_{sf}$ (mJ/m <sup>2</sup> )	23	-	-
$<111>\gamma_{us}$ (mJ/m <sup>2</sup> )	111	-	-
basal $\gamma_{sf}$ (mJ/m <sup>2</sup> )	-	184	238
basal $\gamma_{us}$ (mJ/m <sup>2</sup> )	-	543	606
prism $\gamma_{sf}$ (mJ/m <sup>2</sup> )	-	-	-
prism $\gamma_{us}$ (mJ/m <sup>2</sup> )	-	1015	1059

**Table.3.2** Cu 及び Ru の $\gamma_{sf}$ 、 $\gamma_{us}$ 

**Ru** は Cu との界面に misfit 転位を形成するポテンシャルと、形成しないポテンシャルの 二つについて示している。**Table.4.2** より Ru の不安定積層欠陥エネルギー( $\gamma_{us}$ )は misfit の有無に関わらず、Cu の 5 倍以上の値となっていた。つまり Ru は Cu の 5 倍以上、部分 転位が射出されにくいといくことだ。それゆえ転位の進展はすべて Cu 側のみだったのだろ う

次に Table.3.3 に GEAM ポテンシャル、第一原理計算、実験によるそれぞれの $\gamma_{sf}$ 、 $\gamma_{us}$ を示す。[7]

	・  結応欠陥エネルギー( 〃 )	不安定積層欠陥エネルギー
		$(\gamma_{us})$
GEAM ポテンシャル	23	111
第一原理計算	39	158
実験値	35 ~ 45	-

Table.3.3 GEAM ポテンシャル、第一原理計算、実験による積層欠陥エネルギーの違い

GEAM ポテンシャルの $\gamma_{sf}$ 、 $\gamma_{us}$ は、第一原理計算、実験値の値よりもそれぞれ低くなっ

ていた。つまり GEAM ポテンシャルでも Cu は実際に存在する Cu よりも転位が出やすくなっている。

部分転位が射出されれば応力緩和が起きるので剥離が生じにくくなる。今回の解析で剥離がまったく起こらなかったのは、GEAM ポテンシャルの特性と言える。

## 3.3. Cuのz方向が<011>であるモデルの解析結果

本節及び次節では Cu の面方位による影響を調べるため、Cu の面方位が前節及び前々節 と異なるモデルについて取り扱う。

本節では Cu の面方位が z:<110>, x:<001>, y:<-110>であるモデルを取り扱い、Cu の面 方位についての考察は次節で行う。

#### 3.3.1. 接合エネルギーによる評価

計算系は以下のように変化した。material-connected state の計算系(Cu/Ru 系)は x=10.5nm、y=26.1nm、z=12.7nm であり、総原子数は 273,024 個とした。 material-separated state のCuの計算系(Cu単体系)はx=10.5nm、y=26.1nm、z=6.1nm で、総原子数を141,984個、一方Ruの計算系(Ru単体系)はx=10.5nm、y=26.1nm、z=6.5nm であり、総原子数を131,040個とした。

その他の条件はCuのz方向が<111>であるモデルと等しくした。

平衡状態のエネルギーを求めると Cu-Ru 系が-1,373,094[eV]、Cu 単体系が-496,674[eV]、 Ru 単体系が-870,486[eV]となった。material-connected state と material-separated state の差は 5,394[ev]であり、これを界面の面積で割り、単位面積当たりに換算し、単位変更を 行うと、3.48[J/m<sup>2</sup>]であった。

#### 3.3.2. 界面に対する垂直応力による評価

計算系は x=10.5nm、y=26.1nm、z=12.7nm であり、総原子数を 271,453 個とした。その他の条件は Cu の z 方向が<111>であるモデルと等しくした。

**Fig.3.3.1** に、解析結果概観のスナップショットを示す。Cuのz方向が<111>であるモデ ルのスナップショットと同様に、左図は自由境界原子、欠陥原子のみを可視化した。右図 は、解析モデルを主すべり面に沿って切断し、*σ*<sub>z</sub>をコンター図で表現した。最大値は 12,000[MPa]で、最小値は0[MPa]である。局所的に値がこの範囲に入らない原子もあるが、 その原子はカラーマップ外の色かつ彩度の低い色で表現している。



5.4[ps] ( 緩和計算終了時 )



15[ps]









43[ps]



**Fig.3.3.1** Cuのz方向が<011>であるモデルのスナップショット(概観)

**Fig.3.3.1** の左の図を観察すると、界面の misfit 転位の形状が Cu の z 方向が<111>である モデルが大きく異なっている。Cu の z 方向が<111>であるモデルのように、界面の原子 misfit 転位の存在する部分と存在しない部分に分かれておらず、全面が misfit 転位で覆わ れている。また misfit 転位の z 方向の長さが大きくなっている。

このモデルはき裂端に Cu のすべり面が存在しないので、最初の部分転位が射出されたの は、き裂端ではないところだった。この点が Cu の z 方向が<111>であるモデル及び misfit 転位が存在しないモデルと大きく異なる。43[ps]を見ると、き裂の片側からだけではなく、 両側から射出されている。すべり面がき裂を中心とした xz 面に対称となっていることが確 認できる。転位は直線ではなく転位ループを半分にしたような形で Cu に広がっていった。 そして変位拘束原子に到達すると、それ以上進展しなかった。また Ru 側には転位の進展は 見られなかった。

右のコンター図を観察していく。界面上の応力集中は Cu の z 方向が<111>であるモデル 及び misfit 転位が存在しないモデルよりも大きな範囲に広がっている。き裂周辺に応力集 中が起きている点は同じである。部分転位に関しては、転位芯の応力値が大きく、部分転 位がすべった箇所は応力緩和されている。しかし Cu の z 方向が<111>であるモデル及び misfit 転位が存在しないモデルほど、はっきりとした応力緩和は見られなかった。これはす べり面の傾きが z 方向から大きく傾いているためだと思われる。 また Fig.3.3.2 にき裂近傍の拡大図のスナップショットを示す。Cuのz方向が<111>であるモデル及び misfit 転位が存在しないモデルと同様に、き裂面積は大きくなったが、界面上の界面と平行方向及び Ru 側には進展しなかった。Cu 側には進展していった。Cuのz方向が<111>であるモデル及び misfit 転位が存在しないモデルと比較すると y 方向にやや大きく進展している。だがこのモデルでも界面剥離につながるような挙動は観察できなかった。Cu の面方位を変化させても界面の密着度は大きく変わらないと言える。



5.4[ps] (緩和計算終了時)

30[ps]



50[ps]



Fig.3.3.2 Cuのz方向が<011>であるモデルのスナップショット(き裂近傍の拡大図)

Fig.3.3.3 に全原子  $\sigma_z$ を平均した値の step 数による推移を示す。最初の部分転位が射出 されたときの物性値は、 $\sigma_z = 6.0 \times 10^3$  [MPa]、 =1.85[%]であった。

Cuのz方向が<111>であるモデル及びmisfit転位が存在しないモデルと比較するとかな り滑らかなグラフとなっている。転位射出における応力緩和や計算終了時にも $\sigma_z$ が収束し ている様子は観察できない。すべり面の傾きがz方向から大きく傾いているためだと思われ る。



**Fig.3.3.3** Cuのz方向が<011>であるモデルにおける $\sigma_z$ の step 数による変動

## 3.3.3. 界面に対するせん断応力による評価

計算系は x=10.5nm、y=21.6nm、z=12.7nm であり、総原子数を 269,227 個とした。その他の条件は Cu の z 方向が<111>であるモデル及び misfit 転位が存在しないモデルと等しい。

**Fig.3.3.3** に界面のスナップショットを示す。Cu の z 方向が<111>であるモデルと同様に **Fig.3.1.8** の AB 間を z 方向の上方から観察したスナップショットである。左図では配位数 により着色した後、fcc 構造及び hcp 構造を保っている原子を消去し界面上の欠陥原子と y 方向の自由境界原子のみを可視化した。右図は、 $\tau_{yz}$ によるコンター図である。最大値、最 小値及びカラーマップは Cu の z 方向が<111>であるモデル及び misfit 転位が存在しないモ デルと等しくした。







5.4[ps] ( 緩和計算終了時 )



15[ps]





**Fig.3.3.4** Cuのz方向が<011>であるモデルの界面のスナップショット(せん断応力)

このモデルでは、強制変位に対する misfit 転位の動きを明確に観察することはできなかった。コンター図では青い部分(  $\tau_{yz}$ が低い部分)が徐々に少なくはなったが、Cu の z 方向が<111>であるモデル及び misfit 転位が存在しないモデルほど明確な応力緩和は確認できなかった。

Fig.3.3.5 にこのモデルにおける  $\tau_{yz}$ の step 数による変動を示す。ここでの  $\tau_{yz}$ は全原子の 平均値である。

τ<sub>yz</sub>の最大値は 9.9×10<sup>2</sup>[MPa]だった。この値は Cu の z 方向が<111>であるモデルの 165[%]、misfit 転位が存在しないモデルの 32[%]に当たる値である。このことより misfit 転位の動きは確認できなかったが、応力緩和が起きていたと言える。



**Fig.3.3.5** Cuのz方向が<011>であるモデルにおける $\tau_{_{yz}}$ の step 数による変動

## 3.4. Cuの面方位が<001>であるモデルの解析結果及び考察

本節では、前節に引き続き Cu の面方位による影響を検証する。Cu の面方位を z:<001>, x:<100>, y:<010>とした。

### 3.4.1. 接合エネルギーによる評価

計算系は以下のように変化した。material-connected state の計算系(Cu/Ru 系)は x=10.5nm、 y=27.5nm、 z=12.7nm であり、総原子数は 287,932 個とした。 material-separated state のCuの計算系(Cu単体系)は x=10.5nm、y=27.5nm、z=6.1nm で、総原子数を149,872 個、一方 Ruの計算系(Ru単体系)は x=10.5nm、y=26.1nm、z=6.5nm であり、総原子数を138,060 個とした。

その他の条件はCuの面方位が<111>であるモデルと等しくした。

平衡状態のエネルギーを求めると Cu-Ru 系が-1,449,252[eV]、Cu 単体系が-524,924[eV]、 Ru 単体系が-917,119[eV]となった。material-connected state と material-separated state の差は 7,209[ev]であり、これを界面の面積で割り、単位面積当たりに換算し、単位変更を 行うと、4.01[J/m<sup>2</sup>]であった。

#### 3.4.2. 界面に対する垂直応力による評価

計算系は x=10.5nm、y=27.5nm、z=12.7nm であり、総原子数を 286,362 個とした。そ の他の条件は前節までの三つのモデルと等しくした。

**Fig.3.4.1** に、解析結果のスナップショットを示す。前節までの三つのモデルと同様に、 左図は自由境界原子、欠陥原子のみを可視化した。右図は、解析モデルを主すべり面に沿 って切断し、 *σ*<sub>z</sub>をコンター図で表現した。最大値は 17,000[MPa]、最小値は-3,000[MPa] とした。局所的に値がこの範囲に入らない原子もあるが、その原子はカラーマップ外の色 かつ彩度の低い色で表現している。





Fig.3.4.1 Cuのz方向が<001>であるモデルのスナップショット(概観)

Fig.3.4.1 の左の図より、界面上の misfit 転位は、Cu の面方位が<011>であるモデルと同 じように、界面の原子 misfit 転位の存在する部分と存在しない部分に分かれておらず、全 面が misfit 転位で覆われている。また misfit 転位の z 方向の長さが大きくなっている。

前節までの三つのモデルとは異なり、最初の部分転位のとき、一つの転位が進展するので はなく、ほぼ同時にいくつかの転位が、いくつかのすべり面に沿って射出され、同時に進 展していった。転位の射出はき裂周辺からであった。この様子は 65[ps]の図で明確に観察 できる。このモデルでは、いくつのも主すべり面とき裂が交差していろことが分かる。そ れぞれの転位の形状は直線ではなく、転位ループを半分にした形状、Cu の面方位が<011> であるモデルと同じであった。

前節までの三つのモデルと同じく、転位は変位拘束原子に到達すると、それ以上進展しなかった。また転位が進展するのは Cu 側のみで、Ru 側には進展しなかった。

右のコンター図を見ていく。界面上やき裂周辺の σ<sub>z</sub> が高いのは Cu の面方位が<011>で あるモデルと同じである。だが今回のモデルでは前節までの三つのモデルで見られたよう な部分転位の転位芯への応力集中及び、部分転位がすべった面での応力緩和ははっきりと は確認できなかった。すべり面と z 方向の傾きは Cu の面方位が<011>であるモデルより小 さいが、一度にいくつもの転位が射出されたので、目立った応力緩和、応力集中がなかっ たと言える。

また Fig.3.4.2 にき裂近傍の拡大図のスナップショットを示す。前節までの三つのモデル と同様に、き裂面積は大きくなったが、界面上の界面と平行方向及び Ru 側には進展せずに、 Cu 側のみき裂が進展した。Cu 側での y 方向への進展の仕方は Cu の面方位が<011>である モデルと似ている。だがこのモデルでも界面剥離につながるような挙動は観察できなかっ た。Cu の面方位が<001>のときも界面の密着度は大きく変わらないと言える。



Fig.3.4.2 Cuのz方向が<001>であるモデルのスナップショット(き裂近傍の拡大図)

**Fig.3.4.3** に全原子  $\sigma_z$ を平均した値の step 数による推移を示す。最初の部分転位が射出 されたときの物性値は、 $\sigma_z = 7.0 \times 10^3$  [MPa]、 =3.81[%]であった。

部分転位がいくつも射出された 63[ps]は step 数にすると、約 60,000[step]であるが、 Fig.3.4.3 を見ると 60,000[step]前後で応力緩和が起きている。コンター図でははっきりと 確認できなかったが、応力緩和はどのモデルよりも明確に確認することができた。



**Fig.3.4.3** Cuのz方向が<111>であるモデルにおける $\sigma_z$ の step 数による変動

## 3.4.3. 界面に対するせん断応力による評価

計算系は x=10.5nm、y=21.6nm、z=12.7nm であり、総原子数を 269,227 個とした。その他の条件は前節までの三つのモデルと等しい。

**Fig.3.4.4** に界面のスナップショットを示す。Cuのz方向が<111>であるモデルと同様に **Fig.3.1.8**の AB 間をz方向の上方から観察したスナップショットである。左図では配位数 により着色した後、fcc 構造及び hcp 構造を保っている原子を消去し界面上の欠陥原子と y 方向の自由境界原子のみを可視化した。右図は、 $\tau_{yz}$ によるコンター図である。最大値、最 小値及びカラーマップは Cuのz方向が<111>であるモデル及び misfit 転位が存在しないモ デルと等しくした。 **Fig.3.4.4**の左の図を見ると、misfit 転位の動きを観察することはできなかった。時間ご とに misfit 転位が変化してはいるものの、正確な進展の様子は確認できない。一方、右の 図を見てみると、時間が進むと図の右端の $\tau_{yz}$ が高くなっている。またき裂周辺では、 $\tau_{yz}$ の

高い部分と低い部分が互い違いになっている。Fig.3.1.9 の 16[ps]では、応力集中が起きて その後新たな misfit 転位が射出されているので、このモデルでもそのような現象がおきて いるのではにだろうか。

Second	

0[ps](初期状態)



5.4[ps] ( 緩和計算終了時 )





27[ps]



Fig.3.4.4 Cuのz方向が<001>であるモデルの界面のスナップショット(せん断応力)

Fig.3.3.5 にこのモデルにおける  $\tau_{y_z}$ の step 数による変動を示す。ここでの  $\tau_{y_z}$ は全原子の 平均値である。

 $\tau_{yz}$ の最大値は 7.1×10<sup>2</sup>[MPa]だった。この値は Cu の z 方向が<111>であるモデルの 118[%]、misfit 転位が存在しないモデルの 23[%]に当たる値である。このことより明確な misfit 転位の動きは確認できなかったが、応力緩和が起きていたと言える。



**Fig.3.4.5** Cuのz方向が<001>であるモデルにおける $\tau_{yz}$ の step 数による変動

### 3.4.4. 界面剥離に対する Cu の面方位の影響

本節では Cu の面方位が界面剥離に与える影響を考察するため、Cu の z 方向がそれぞれ <111>、<011>、<001>であるモデルを比較していく。

まず前節で考察した misfit 転位の影響が Cu の z 方向がそれぞれ<011>、<001>であるモ デルにも当てはまるかを考える。

接合エネルギーによる評価。第3章よりCuのz方向が<111>であるモデルは4.56[J/m<sup>2</sup>]、 Cuのz方向が<011>であるモデルは3.48[J/m<sup>2</sup>]、Cuのz方向が<001>であるモデルは 4.01[J/m<sup>2</sup>]となった。<111>モデルと比較して<011>モデルは24%、<001>モデルは12%小 さな値だった。接合エネルギーのみ考慮すると、<111>モデル、<001>モデル、<011>モデ ルの順に安定である。

界面に対する垂直応力による評価。各モデルの最初の部分転位が射出されたときの物性値 を Table.3.3 に示す。 $\sigma_z$ に関しては、<111>モデルと比較して<011>であるモデルは 15%、 <001>モデルは 35%大きな値となった。 に関しては、<111>モデルと比較して<011>であ るモデルは 46%、<001>モデルは 114%大きな値となった。

	$\sigma_z$ [MPa]	[%]	step
<111>モデル	5.2×10 <sup>3</sup>	1.78	27,000
<011>モデル	6.0×10 <sup>3</sup>	2.60	37,000
<001>モデル	7.0×10 <sup>3</sup>	3.81	52,000

**Table.3.4** 転位射出時における Cu の z 方向がそれぞれ<111>、<011>、<001>であるモデ ルの物性値

**Fig.3.4.6** に Cu の z 方向がそれぞれ<111>、<011>、<001>であるモデルにおける $\sigma_z$ の step 数による変動を示す。全体的な傾向として、<111>モデル、<011>モデル、<001>モデ ルの順に高い値となっている。



**Fig.3.4.6** Cuのz方向がそれぞれ<111>、<011>、<001>であるモデルにおける $\sigma_z$ の step 数による変動

界面に対するせん断応力による評価。各モデルの misfit 転位の動きを、Fig.3.1.8、Fig.3.3.3、 Fig.3.4.3 より比較してみると、<111>モデルは明確な misfit 転位の動きを確認することが できるが、<011>モデル、<001>モデルはスナップショットを見る限り、misfit 転位のはっ きりした動きを確認することは出来なかった。

**Fig.3.4.7** に Cu の z 方向がそれぞれ<111>、<011>、<001>であるモデルにおける $\tau_{yz}$ の step 数による変動を示す。<111>、<011>、<001>モデルの最大値はそれぞれ、misfit 転位 が存在しないモデルの最大値 3,000[MPa]の 20%、33%、23%となった。つまり $\tau_{yz}$ は misfit 転位が存在しないモデルと比較して十分に緩和されている。



**Fig.3.4.7** Cuのz方向がそれぞれ<111>、<011>、<001>であるモデルにおける $\tau_{yz}$ の step

数による変動

以上の点より、前節で考察した misfit 転位の影響は3モデルともに当てはまることが分かった。

次に Cu の面方位による影響について考察する。

転位ループの発生する方向や、部分転位射出時の応力値は異なるものの、misfit 転位の有 無で確認したような明確な差異は観察されなかった。

# 第4章 結果

本研究では Cu-Ru 間の界面剥離強度を取り扱ったのだが、どのモデルでも界面剥離は起きることはなかった。このことは Cu-Ru 間の界面がとても密着性が良く安定していることを示している。

全モデルの解析を通して、Ruには部分転位の射出及び進展が見られなかった。これはCu とRuの積層欠陥エネルギーを比較した場合、Ruのほうが5倍以上大きいことに起因した。 またき裂もCu側には進展したが、Ru側には進展しなかった。

界面に存在する misfit 転位について。界面に垂直応力を加えたときは垂直応力及び主す べり面での応力緩和には影響をあたえないが、ひずみに注目すると、部分転位が Cu に射出 されるのを妨げる働きがあった。一方、界面にせん断応力を加えたときは界面上 misfit 転 位の移動及び新たな misfit 転位の射出があり、せん断応力を緩和していた。

misfit 転位が存在すると、密着エネルギーは小さくなり、界面上に応力集中場ができる。 今回は剥離に至らなかったが、さらに大きなひずみをかけると、misfit 転位の存在するモデ ルのほうが、剥離に至りやすいだろう。

Cuの面方位による影響については、大きな違いは確認できなかった。

## 参考文献

- 岩崎富生 Adhesion-Strength Calculation and Measurement Techniques for Interfaces between Nano-scale Thin Films 応用数理 Vol.14, No.4 (20041222) pp. 334-345
- [2] 北村隆行 平方寛之 高橋可昌 低次元ナノ構造体の界面剥離発生・伝ぱ過程のその 場観察 M&M2005 材料力学カンファレンス No.05-9 p19,20
- [3] 結城良治、石川晴雄、岸本喜久雄、許金泉編著 培風館 「界面の力学」(1993)
- [4] X.W.ZHOU, H.N.G.WADLEY, R.A.JOHNSON ATOMIC SCALE STRUCTURE OF SPUTTERED METAL MULTILAYERS Acta mater. 49 (2001) p.4005 - 4015
- [5] T.Iwasaki Molecular dynamics study of adhesion strength and diffusion at interface between interconnect materials and underlay materials Computational Mechanics 25 (2000) p.78 - 86
- [6] 原祥太郎 ナノレイヤー金属材料における界面と転位の相互作用 The 19<sup>th</sup> Computational Mechanics Conference No.06-9 p.607、608
- [7] N.Bernstein E.B.tadmor Tight-binding calculations of stacking energies and twinnability in fcc metals (2004)

# 謝辞

本研究を進めるにあたり、酒井伸介教授、泉聡志助教授、原祥太郎助手をはじめとする酒 井・泉研究室のみなさまには多大なご支援をいただきありがとうございました。

分子動力学法を学習するうえで、原助手にはとてもお世話になりました。質問に丁寧に答 えて頂いたり、助言を頂いたりしたこと、とても感謝しています。泉助教授には研究会の 度に、研究の指針となるような助言をしていただけて、とても参考になりました。

また諸先輩方には温かく接していただき、とても楽しい研究室生活を過ごすことが出来ました。

同輩の皆さんの頑張りは研究を進める上で大きな励みとなりました。

充実した一年を過ごすことが出来たのは、お世話になった皆さんのおかげです。本当にあ りがとうごさいました。 以上

# <u>p.1-p.72完</u>

<u>卒業論文</u>

# <u> 平成19年 2月 2日 提出</u>

# <u>50245 松本 祐樹</u>